한국정경신문 (Korea)

PMT orders EV Group maskless lithography system - January 24, 2024

지식과 문화가 있는 뉴스

PMT has ordered a LITHOSCALE® maskless exposure system from EVG. The LITHOSCALE system will be installed at PMT's headquarters in Asan-si, Chungcheongnam-Do, South Korea, where it will be used in the production of next-generation MEMS-based probe cards for wafer-level testing of advanced NAND, DRAM and HBM devices. "Fine-pitch probe card manufacturing involves many lithographic patterning steps, which can significantly drive up cost of ownership." stated Dr. Yong-Ho Cho, CEO of PMT. According to Young-Sik Yun, general manager of EV Group Korea, "We are pleased to support PMT in their efforts to expand their product portfolio and shorten their development cycles."



제조비용 증가 최소화가 필요하다"며 "기존의 마스크 얼리이너를 이용한 리소그래피 공정을 EVG의 마스크리 스 노광 장비인 LITHOSCALE로 대체함으로써 제조비용의 절감이 가능하고, 공정 개발 속도 또한 혁신적으로 단축 가능할 뿐 아니라 프로세스 성능도 더욱 향상할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 우리는 첨단 프 로브 카드 제조 및 개발에 있어 EVG의 LITHOSCALE뿐 아니라 다양한 프로세스 솔루션을 통한 협력을 이어 갈 것으로 기대한다"고 말했다.



(자료=피엠티)

EVG의 혁신적인 LITHOSCALE® 마스크리스 노광 시스템은 높은 수준의 유연성이나 제품 다양성을 필요로 하는 시장 및 애플리케이션의 리소그래피 요구를 충족한다.

EVG의 MLE™(Maskless Exposure) 기술을 적용한 LITHOSCALE은 높은 수준의 유연성이나 제품 다양성을 필요로 하는 시장 및 애플리케이션의 리소그래피 요구를 충족한다. LITHOSCALE은 실시간 데이터 전송과 즉 각적인 노광을 가능하게 하는 강력한 디지털 프로세싱 능력과 높은 구조적 분해능 및 생산 처리량 확장성을 결합함으로써, 기존 리소그래피 방식의 병목 문제를 해결한다. EVG의 LITHOSCALE은 신속한 프로토타입 개 발에 매우 이상적인 솔루션으로 틴어라운드 시간과 연구개발 주기를 앞당길 수 있게 해준다.

MEMS 제조는 특히 미세공정의 복잡성으로 인해 공정 난이도가 높다. 그 결과 마스크 제조비용 증가를 피할 수 없는 한계가 있다. 마스크를 사용하지 않는 LITHOSCALE은 높은 초점 심도와 고분해능(2μm 수준의 L/S) 의 성능을 보장함에 따라, 마스크를 사용하지 않고도 미세 피치 프로브 카드의 핵심 기술인 고밀도 재배선 레 이어(RDL)와 비어(Via) 연결이 가능하게 해준다.

EVG 한국지사의 운영식 지사장은 "피엠티가 자사 제품 포트폴리오를 확장하고 개발 시간을 단축할 수 있도 록 돕게 되어 매우 기쁘다"고 밝히고 "프로브 카드를 사용하는 웨이퍼 레벨 테스트는 디바이스 생산 수율을 높이고 다이당 전반적인 테스트 비용을 낮추기 위해서 필수적인 공정이다. LITHOSCALE은 높은 분해능, 다 양한 많은 제품 설계를 처리할 수 있는 뛰어난 유연성, 낮은 소유 비용 특성을 결합한 독창적인 솔루션으로서, 미세 피치 웨이퍼 프로브 카드 제조용으로 매우 이상적"이라고 말했다.

http://kpenews.com/View.aspx?No=3104163